



主要特点

- 提供大小相等、相位相反的两相电压
- 提供穿刺电压, 可以对晶圆进行穿刺
- 提供电容检测, 用来指示无晶圆、晶圆吸附、释放状态
- 提供穿刺检测, 用来指示穿刺是否成功
- LCD显示, 可以显示吸附和穿刺电压以及电阻、电容检测值

性能简介

高真空静电吸盘控制器是双极可逆电源, 特为在真空环境下静电吸盘吸附Wafer的控制应用而设计。通过控制器的两个高压接头分别向静电吸盘中通极性相反的0~500V吸附高压, 同样的, 也可以提供极性相反的释放电压。此外, 本控制器可以实现对Wafer的穿刺功能, 通过穿刺高压接口向静电吸盘提供1000~4000V的穿刺电压。同时, 该控制器可监测Wafer的吸附/释放状态以及高压穿刺结果。

控制器预留有DB9接口可以实现与上位机通讯, 通过上位机下发指令对控制器的功能进行控制, 同时可以监测控制器的运行状态。

技术参数

参数	
输入/Input	100~264VAC/47~63Hz
通讯方式/Communication	RS-485 (RTU&ASCII)
吸附电压/Clamping Voltage	0~±500V, ±2%FS
穿刺电压/Penetration Voltage	1000~4000V, ± 5%FS
环境/Ambient	运行/Operating: 0°C~45°C; 25~60%HR
	存储/Storage: -35°C~85°C; 25~60%HR
尺寸/Dimensions	482.6mm×88.1mm×361.8mm(W×H×D)